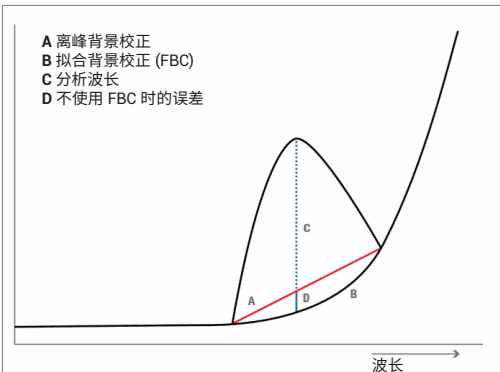


ICP-OES 远离背景和干扰困扰

准确、轻松、可靠



拟合背景校正可计算真实的背景信号，提高准确度，节省方法开发所需时间

ICP Expert 软件提供的算法助您获得准确可靠的结果

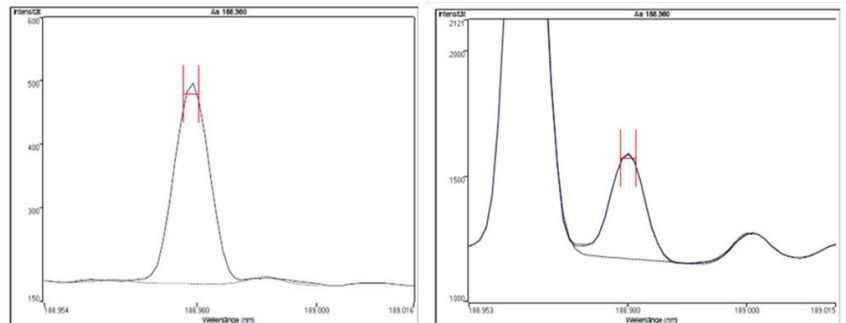
安捷伦提供两种不同的 ICP-OES 背景校正算法：

- 拟合背景校正 (FBC)，用于准确、快速地校正简单和复杂的背景
- 快速自动曲线拟合技术 (FACT)，用于校正高度复杂的背景

拟合背景校正 (FBC)

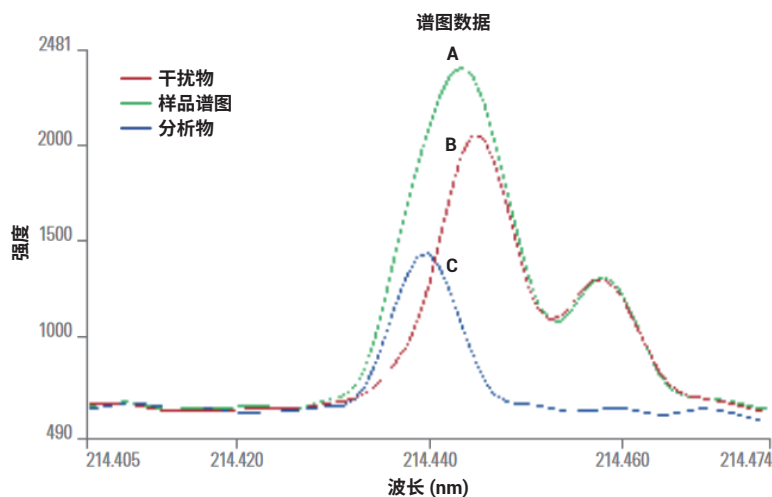
特点

- 采用精细的数学算法对分析物谱峰中的真实背景信号建模
- 自动准确地校正简单和复杂的背景结构
- 轻松处理难以设定离峰校正点的谱图背景
- 远离令人困扰的离峰背景点选择工作



安捷伦的拟合背景校正可自动完成准确的背景校正，即使对于难以设定离峰校正点的谱图也是如此 (右图)

FACT (快速自动曲线拟合技术)



通过 FACT 消除光谱干扰

Fe 在 Cd 214.438 nm 处产生的干扰的光谱解析。如图所示：

- A. 土壤样品中的峰
- B. 干扰物的 FACT 模型
- C. Cd 分析物的校正信号

元素与波长 (nm)	离峰 MDL (ppm)	拟合 MDL	FACT MDL (ppm)
Pb 261.618	1.69	1.363	0.119

使用 Agilent 5100/5110 ICP-OES, 采用离峰、拟合和 FACT 背景校正技术, 测定汽油的煤油稀释液中 Pb 261.618 nm 的方法检测限。使用 FACT 对汽油的煤油稀释液的复杂结构背景建模, 可更为准确地测定分析物信号, 降低检测限

特点

- 相比元素间干扰校正 (IEC) 技术, FACT 能够更简单便捷地消除复杂的质谱干扰
- 通过使用一种更加复杂的谱图建模技术, 准确校正质谱干扰
- 可对高度复杂的背景结构进行准确的背景校正, 这是其他技术不能实现的

优势

- 简单易用: 通过分别测定预期组分 (通常为空白溶液、纯分析物溶液和纯干扰物溶液) 来创建 FACT 模型
- 节省时间: 可以在采集分析数据之前或之后创建 FACT 模型, 从而减少样品前处理工作, 避免样品重新分析和错误的数据分析
- 改善有机溶剂等复杂样品的检测限, 而此类样品通常会产生复杂的结构背景

如需了解更多信息, 请访问:

www.agilent.com/chem/5110icpoes

查找当地的安捷伦客户中心:

www.agilent.com/chem/contactus-cn

免费专线:

800-820-3278, 400-820-3278 (手机用户)

联系我们:

LSCA-China_800@agilent.com

在线询价:

www.agilent.com/chem/erfq-cn

安捷伦科技大学:

<http://www.lasca-china.com.cn/agilent>

浏览和订阅 Access Agilent 电子期刊:

www.agilent.com/chem/accessagilent-cn

本资料中的信息如有变更, 恕不另行通知。

© 安捷伦科技 (中国) 有限公司, 2017
2017 年 10 月 1 日, 中国出版
5991-8452ZHCN